

# 케이씨텍-Hitachi, 특허분쟁 종료

## CMP 슬러리 관련 특허소송 취하 합의 ... 불확실성 해소로 사업박차

반도체 디스플레이 장비·소재 생산기업 케이씨텍(대표 고석태·주재동)이 일본 Hitachi Chemical과의 합의에 따라 미국과 국내에서 진행해온 반도체 소재 CMP(Cheical Mechanical Polishing) 슬러리 관련 특허소송을 취하했다고 4월25일 발표했다.

CMP 슬러리는 반도체 웨이퍼 표면을 평탄화하는 CMP 공정에 사용되는 연마액이다.

Hitachi Chemical이 2011년 11월 미국에서 관련특허를 침해했다며 소송을 제기하자 케이씨텍은 2012년 7월 국내에서 특허무효 심판을 제기했다.

양사가 제소금지 합의로 소송을 취하함에 따라 모든 분쟁이 종결됐다.

케이씨텍은 특허문제로 불거진 불확실성을 해소하고 CMP 슬러리 사업을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2013/04/25>